DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010068018 \*\*Image available\*\*
WPI Acc No: 1994-335731/199442

XRAM Acc No: C94-152605 XRPX Acc No: N94-263610

Active matrix system LCD device of reduced external electric field influence and prevented redn. of driver reliability - where substrate has first insulation film which separates gate wiring from source wiring and second insulation to separate source wiring from element electrode

Patent Assignee: SEIKO EPSON CORP (SHIH )
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

**JP 6258659** A 19940916 JP 9341455 A 19930302 199442 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9341455 A 19930302

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 6258659 A 4 G02F-001/136

Abstract (Basic): JP 6258659 A

Substrate has first insulation film for sepg. a gate wiring from a source wiring and second insulation layer for sepg. a source wiring from a picture element electrode and formed on a driver.

USE - Redn. of driver reliability can be prevented and bad influence by an external electric field is reduced.

Dwg.2/3

Title Terms: ACTIVE; MATRIX; SYSTEM; LCD; DEVICE; REDUCE; EXTERNAL;

ELECTRIC; FIELD; INFLUENCE; PREVENT; REDUCE; DRIVE; RELIABILITY;

SUBSTRATE; FIRST; INSULATE; FILM; SEPARATE; GATE; WIRE; SOURCE; WIRE;

SECOND; INSULATE; SEPARATE; SOURCE; WIRE; ELEMENT; ELECTRODE

Derwent Class: L03; P81; U14

International Patent Class (Main): G02F-001/136

International Patent Class (Additional): G02F-001/1345

File Segment: CPI; EPI; EngPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04586759 \*\*Image available\*\*
LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.: **06-258659** [JP 6258659 A]

PUBLISHED: September 16, 1994 (19940916)

INVENTOR(s): SHIMONE SUMISATO

APPLICANT(s): SEIKO EPSON CORP [000236] (A Japanese Company or Corporation)

, JP (Japan)

APPL. NO.: 05-041455 [JP 9341455]

FILED: March 02, 1993 (19930302)

INTL CLASS: [5] G02F-001/136; G02F-001/1345

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 14.2

(ORGANIC CHEMISTRY -- High Polymer Molecular Compounds)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R119 (CHEMISTRY -- Heat Resistant

Resins)

JOURNAL: Section: P, Section No. 1842, Vol. 18, No. 657, Pg. 55,

December 13, 1994 (19941213)

### **ABSTRACT**

PURPOSE: To save space without degrading the reliability on a driver by arranging a driver nearer a pixel display part than a sealing part.

CONSTITUTION: A TFT 102 for pixel switching consisting of a gate electrode, a source electrode, a first interlayer insulating film 113, etc., and a TFT (driver) 103 for driving the pixel electrode are simultaneously formed on an insulating substrate 101. Polyimide is then applied as a second interlayer insulating film 104 and is patterned by a dry etching method. The parts to be etched in the second interlayer insulating film 104 are formed in the parts nearer the outer periphery than the part 108 (sealing part 110) where an active matrix substrate and a counter substrate 107 are adhered at this time. Then, the driver 103 exists on the pixel display part side on the side inner than the sealing part 110 and, therefore, there is no need for assuring the space for the driver outside the sealing part 110. Since the second interlayer insulating film 104 on the driver 103 is not removed, the driver 103 is not damaged by etching.

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-258659

(43)公開日 平成6年(1994)9月16日

(51) Int. Cl. 5

識別記号

500

FΙ

G02F 1/136 1/1345 9018-2K

8707-2K

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全4頁)

(21)出願番号

特願平5-41455

(22)出願日

平成5年(1993)3月2日

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 下根 純理

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

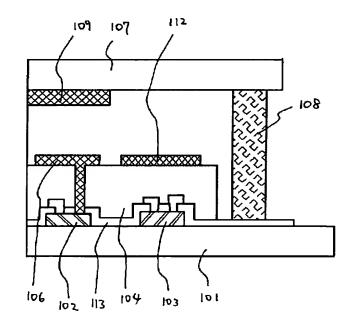
(74)代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外1名)

## (54) 【発明の名称】液晶表示装置

### (57) 【要約】

【目的】 有機薄膜を用いた層間絶縁膜上に画素電極を 形成した液晶表示装置に於いて、ドライバーの信頼性を 低下させる事無く対向基板間距離を一定に保ち、かつ基 板の小型化を図る事を目的とする。

【構成】 有機薄膜上に画素電極を形成し、同時にシール部よりも画素表示部寄りに形成したドライバー上、及びシール部にも有機薄膜を形成する。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ドライバー内蔵アクティブマトリクス方式の液晶表示装置において、アクティブマトリクス基板はゲート配線とソース配線を層間分離する第一の層間絶縁膜と、ソース配線と画素電極を層間分離する第二の層間絶縁膜とを備え、ドライバーを対向する2枚の基板の接着部よりも画素表示部寄り配置することと、少なくとも第二の層間絶縁膜は前記ドライバー上にも形成する事と、少なくとも第二の層間絶縁膜は対向基板との接着部及びその外周には形成しない事と、前記ドライバー上の層間絶縁膜上には他の配線などと導通をとらず浮遊電位としたITOなどの導電性薄膜を形成することと、対向する基板のドライバーに対応する位置には対向電極である導電性薄膜を形成しない事を特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 請求項1において第二の層間絶縁膜はポリイミド樹脂、ポリイミドアミド樹脂、ポリアミド樹脂などの有機樹脂からなる事を特徴とする液晶表示装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は液晶表示装置に関する。 【0002】

【従来の技術】有機薄膜上に画素電極を形成したことを特徴とする従来例としては、特公平1-35351号のようなものが上げられる。この例では画素電極としてアルミニウムを用い、反射型液晶表示装置の構成としている。

【0003】また一般にドライバーをアクティブマトリクス基板に内蔵する場合、特開昭64-68725号のごとくドライバーは基板間の接着部(以下シール部と称 30 する)よりも画素部に対して外側に配置され、かつドライバーの耐湿性向上のためポリイミド等の有機樹脂膜で封止してある。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし画素表示部の面積を変える事無くアクティブマトリクス基板を小型化しようとするとき、従来のようにドライバーが外側に配置されているとドライバー用のスペースが必要であり、結果として基板面積の増大を招く。また通常アクティブマトリクス基板は1枚の絶縁性基板上に多数個形成して一40個当たりの製造コストを下げているが、基板面積が増大すると製造コストを下げれないと言う課題を有する。

【0005】本発明の目的は、ドライバーの信頼性を低下させる事無く省スペース化を図り、同時に製造コストを下げる事の可能な液晶表示装置の構造を提供する事にある。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明はドライバー内蔵 アクティブマトリクス方式の液晶表示装置において、ア クティブマトリクス基板はゲート配線とソース配線を層 50 間分離する第一の層間絶縁膜と、ソース配線と画素電極を層間分離する第二の層間絶縁膜とを備え、ドライバーを対向する2枚の基板の接着部よりも画素表示部寄り配置することと、少なくとも第二の層間絶縁膜は前記ドライバー上にも形成する事と、少なくとも第二の層間絶縁膜は対向基板との接着部及びその外間には形成しない事と、前記ドライバー上の層間絶縁膜上には他の配線などと導通をとらず浮遊電位としたITOなどの導電性薄膜を形成することと、対向する基板のドライバーに対応する位置には対向電極である導電性薄膜を形成しない事を特徴とする。

#### [0007]

【実施例】本発明による一実施例の液晶表示装置の平面 図を図1に示し、そのA-A'間における断面図を図2 に示す。絶縁性基板101上に導電性半導体、真性半導 体、ゲート絶縁膜、ゲート電極、ソース電極、第一の層 間絶縁膜113からなる画素スイッチング用TFT(以 下画素TFTと称す)102及び前記画素TFT群の駆 動用TFT(以下ドライバーと称す)103を同時に形 20 成する。次に第二層間絶縁膜104として例えばポリイ ミドを 2 μ m程度の膜厚となるように塗布する。前記ポ リイミドを乾燥後、クロム薄膜を1000Å程度堆積 し、パターニングしてエッチングマスク105とする。 この後ドライエッチング法にて第二層間絶縁膜104を パターニングする。このとき第二層間絶縁膜104の被 エッチング部分は、画素TFT102の画素電極接続部 と、対向電極109とアクティブマトリクス基板との導 通部と、アクティブマトリクス基板と対向基板との接着 部(以下シール部と称す)110、及びシール部110 よりも外周部とする。エッチング終了後エッチングマス ク105を剥離し、画素電極106をITOで形成す る。このとき第二層間絶縁膜104上のドライバー部に 対応する位置にもITOを形成し、シールド112とす る。次に絶縁性基板101と対向基板107を接着部 (以下シール部と称す) 110で接着するがその際ギャ ップ材を混入した接着剤で接着する。最後にギャップ材 を混入した液晶を封入する。

【0008】別の実施例として前記実施例に加え、第二層間絶縁膜104の被エッチング部分をシール部110、画素TFT102の画素電極接続部、対向電極109とアクティブマトリクス基板との導通部、及びアクティブマトリクス基板の外部接続端子部とした。これを用いると通常A1を主成分とする導電性薄膜を用いるドライバー103から外部接続端子への配線の腐食を低減可能であり結果として、従来のようにアクティブマトリクス基板形成後にポリイミドで封止する事無く液晶表示装置の信頼性を保つ事が可能となった。

【0009】以上の実施例ではエッチングマスクとして クロムを用いたが、エッチングマスクになるものなら例 えば窒化ケイ素膜や二酸化ケイ素膜のような別の材料で (3)

もかまわない。

【0010】さらにエッチングマスクの除去は必ずしも必要ではなく、エッチングマスクを介して層間絶縁膜の上層に画素電極を形成する事も可能である。この場合エッチングマスク剥離工程の削除を伴うので、第二層間絶縁膜へのダメージを更に低減できる。またエッチングマスクのパターニング後、フォトレジストの剥離を行うと第二層間絶縁膜104のエッチング時に、エッチングマスクがエッチングガスに曝されてダメージを受け易くなるため、前記フォトレジストは剥離しないまま第二層間10絶縁膜のエッチングを行うのが望ましい。

【0011】また画素電極も例えばアルミニウムが使えるなど ITOには限らない。

【0012】以上が本発明の実施例であるが、シール部 110には比較的水分の侵入経路となりやすい有機樹脂 を用いた第二層間絶縁膜104が形成されていない。従 って第二層間絶縁膜104を経路として液晶層に水分が 侵入する事は防げ、結果として液晶の劣化を防止でき

【0013】同時にドライバー103はシール部110より内側である画素表示部側にあるためわざわざドライバー用のスペースを確保する必要がなく省スペース化がはかれる。さらにドライバー103上の第二層間絶縁膜104を除去せずに済むためドライバーはエッチングによるダメージを受けない。また従来の構造では最終的にポリイミドからなるドライバー保護膜114を形成してドライバーを封止する必要があったが本発明を用いるとすでに第二層間絶縁膜104で覆われているのでさらなる封止は不必要となる。

【0014】またITOなどの導電性薄膜であるシール 30 ド112がドライバー上の第二層間絶縁膜104上に存在するため外部電場によるドライバーの信頼性低下を招かない。同時に対向基板上のシールド112に対応する位置には対向電極を形成しない事によりシールド112

近辺の電界強度は格段に低下する。よってドライバー 1 0 3 は外部電場を受けにくくなる。

[0015]

【発明の効果】本発明を用いれば、ドライバーはシール部よりも画素表示部寄りにあるため省スペース化が図れる。またドライバー上には画素部と共に同じ膜厚の層間絶縁膜を形成するのでドライバーに液晶が直接触れる事が無くドライバーが液晶封入部にあっても信頼性の低下は防げる。

【0016】またドライバーは層間絶縁膜上の導電性薄膜にも保護されているため、外部電場による悪影響も低減できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例記載の液晶表示装置の平面図。

【図2】 実施例記載の液晶表示装置のA-A'間に於ける断面図。

【図3】 実施例の工程を表す断面図。

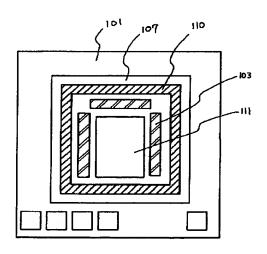
【図4】 従来例の液晶表示装置の断面図。

【符号の説明】

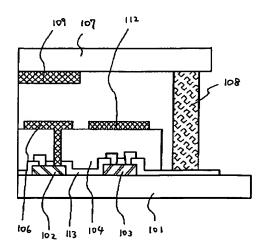
20

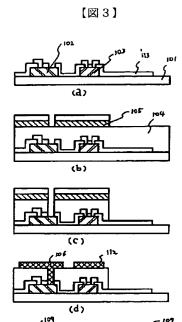
- 101 ガラス基板
- 102 画素TFT
- 103 ドライバー
- 104 第二層間絶縁膜
- 105 エッチングマスク
- 106 画素電極
- 107 対向基板
- 108 接着剤
- 109 対向電極
- 110 シール部
- 0 111 画素部
  - 112 シールド
  - 113 第一層間絶縁膜
  - 114 ドライバー保護膜

【図1】

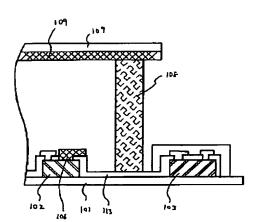


【図2】





**(E)** 



[図4]